PAT-NO:

JP362065477A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 62065477 A

TITLE:

ORGANIC THIN FILM RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

March 24, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MOTOMA, NOBUHIRO MIZUSHIMA, KOICHI AZUMA, MINORU MIURA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60205726

APPL-DATE:

September 18, 1985

INT-CL (IPC): H01L029/91, H01L049/02

US-CL-CURRENT: 257/E51.048

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate extremely high speed switching operation by a method wherein an organic thin film in a junction structure of metal/organic thin film/ metal is composed of a laminated structure of thin films containing donor type organic molecules and thin films containing acceptor type organic molecules to provide rectifying characteristics.

CONSTITUTION: 10 layers of LB films 2 made of tetrathiafulevalene (TTF) as a

donor type molecule are formed on an Al substrate 1 and 10 layers of LB films 3 made of tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as an acceptor type molecule are formed on the films 2. An Al electrode 4 is formed on the films 3 by evaporation. When a bias is zero, the ionizing potential IPD of the LB film 2 containing donor type molecules is small and the electron affinity EA of the LB film 3 containing acceptor type molecules is large and difference between those two values is, for instance, less than about 1eV. When a forward bias is applied, electron transition from the electron conditions of the LB film 2 to the electron conditions of the LB film 3 is induced and a forward current is applied. When a reverse bias is applied, potential barrier between the electron conditions of the LB film 3 and the electron conditions of the LB film 2 is high so that no electron transition is induced and hence no current is applied.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

⑫公開特許公報(A)

昭62-65477

MInt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和62年(1987)3月24日

H 01 L 29/91 49/02 7638-5F 6466-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

有機薄膜整流案子 49発明の名称

> 願 昭60-205726 2)特

昭60(1985)9月18日 頣 经出

信 Ы 砂発 明 者 源 公

弘 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

島 水 723 明 者 東 明 者 79発

川崎市幸区小向東芝町1番地 実

株式会社東芝総合研究所内

眀 Ξ 浦 明 者 勿発

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内

株式会社東芝 頣 人 の出

川崎市幸区堀川町72番地

外2名 弁理士 鈴江 武彦 個代 理 人

1. 発明の名称

有极薄膜整流素子

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 金属/有機薄膜/金属の接合構造を存し、 有機薄膜をドナー性有機分子を含む薄膜とアクセ プタ性有限分子を含む薄膜の積層構造としたこと。 を特徴とする有機薄膜整旋業子。
- ドナー性有機分子を含む薄膜とアクセブ タ性有機分子を含む薄膜の間に絶縁性有機分子か らなる薄膜を介在させた特許請求の範囲第 1 項記 載の有機薄膜整液素子。
- 有機掃機はラングミュア・プロジェット 法により形成される特許請求の範囲第1項記載の 有機薄膜整流素子。
- 3. 発明の詳報な説明
- (発明の技術分野)

本発明は有機薄膜を用いた金属/有機薄膜/金 旗橋造の整統素子に関する。

(発明の技術的背景とその閲覧点)

近年、ラングミュア・プロジェット法(以下、 LB法)に代表される有機分子の超砷膜形成技術 の進展により、有機薄膜を用いた素子の検討が断 発化している。ダーラム(Duhrass)大学のロバ ーツ(G. G. Rojberts)の、有機溶膜を絶縁膜 として用いたMIS煮子の研究を代表として、こ の種の研究が各研究機関で行われている。有機材 料中では一般に、無限半導体と比較して電子移動 度が小さいため、これまで超高速素子への応用例 は発表されていない。

無機半導体材料を用いた素子においても、サブ psec の動作速度を有する非糖形素子の提案は、 分子籍エピタキシー法(MBE法)で形成した GaAs-ALGaAsヘテロ接合を用いた組格 子素子等に僅かに見られるに過ぎない。しかしこ の様な無機半導体を用いた超格子素子は、極めて 高価な製膜装置と厳密な制御を必要とする。また 高速化のためには、各層の厚みを数10人といっ た薄いものにすることが必要である。この様な舞 い無機半導体器膜を用いた素子では、ヘテロ接合 界面の結晶性劣化のために再現性が悪く、また船的に権めて不安定なものとなり、耐久性に乏しい。 (発明の目的)

本発明は上記した点に載みなされたもので、有機分子の薄膜を用いて超高速のスイッチング動作を可能とした有機薄膜整液素子を提供することを目的とする。

(発明の概要)

本発明は、金属/有機掃製/金属の接合構造を 用い、その有機掃製を、ドナー性有機分子即ちて オン化ポテンシャル(IP)が小さく他の分子の分を 電子を供給して自らはプラスのイオン状態の分子なり 易に分子を含む酵類と、アクセプタ性有機分子を 多電子観和力(E)が大きく他の分子から電子を 受取り自らはマイナスのイオン状態になり 多取り自らはマイナスのイオン状態に特性を 受取りを含む薄膜の機器構造として、整度特性を したものである。

有機分子の特徴として、分子設計と化学合成により、そのイオン化ポテンシャル(IP)と電子観和力(E)の値を任意に制御できること、更に

速い整流素子が得られる。しかも、無機半導体の 超格子構造を形成する場合に比べると、製製が容 場であり、接合界面の結晶性劣化という問題もないため、熱的安定性に優れ、価格の点でも有利に なる。従って本発明の整変素子は、各種論理素子 や配信素子等への応用が期待される。

(発明の実施房)

以下本発明の実施例を説明する。

A & 基板上に、ドナー性分子としてテトラチアフルパレン(TTF)を用いたしB膜を10間形成し、更にその上にアクセプタ分子としてテトラシアノキノジメタン(TCNQ)を用いたしB膜を10層形成した。そしてこの上にA & 電極を蒸着法により形成した。

第2回はこの整度素子の動作を説明するための パンド図である。 (a) は繋パイアス時であり、 これらの値が広範囲にわたっていること、が挙げられる。これは、無機材料にはない有機材料に特有のものである。しかも、LB法に代表される有機嫌膜の形成技術の進歩により、多種多様の分子の単分子膜や組得膜が均一かつ欠陥のない状態で形成できる。

また有機分子は間殻構造をしているため、金銭との界面に形成される界面単位の数は比較的少ない。

(発明の効果)

本発明によれば、十分に確い2種の有機薄膜を金属の間に挟むという簡単な構成で、応答速度の

第3回はこの実施例の整複素子について測定した電流一電圧特性である。図示のように整流特性、即ちダイオード特性を示す。

全またこの実施例の整流素子の周波取応答特性を 例定したところ、500G比まで応答することが 確認され、高速スイッチング動作が可能であるこ とが明らかになった。

本実施例の整流素子での整規特性のメカニズム

と高速応答特性の理由を少し詳しく説明すると、 以下の通りである。 バイアス零の状態でドナー性 分子を含むLB膜2の電子状態を占有していた電 子は、バイアス電圧が、

一方、上述の電子選移は、運移に関連する各々の電子状態間の連移行列要素Hifの大きさによって支配され、選移に要する時間はその運移行列要素Hifは、素Hifの逆数に比例する。選移行列要素Hifは、ドナー性分子、アクセプタ性分子の種類、その間

ノリニウムヨーダイド (N M Q) 、アクリジン (A d) 、 n ーメチルフェナジニウム メチルスルフェイト (N M P) 、 1 . 2 - ジ (n - エチルー4 - ピリジウム) エチル ヨーダイド ((D E P E) ፣ ↑ 1 ! ~) 。

またアクセプタ性分子としても上記実施例の TCNQの他に以下のようなものを用い得る。

2 - メチル- 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (M T C N Q) 、 2 . 5 - ジメチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (D M T C N Q) 、 2 . 5 - ジエチルー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキジメタン (D E T C N Q) 、 2 - メトキシー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキジメタン (M O T C N Q) 、 2 . 5 - ジメトキシー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (D M O T C N Q) 、 2 - メトキシー 5 - エトキシー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (M O E O T C N Q) 、 2 - メトキシジヒドロジオキサベンゾー 7 . 7 . 8 . 8 - テトラシアノキノジメタン (M O D O T C N Q) 、 2 - クロロー

の距離および位置関係によって決まるが、両分子を適当に選ぶことにより、1meV~1eVの範囲のものを設定することが可能である。従ってスイッチング時間が1psec ~10°3 psec と極めて高速のスイッチング動作が可能となるのであ

本発明は上記した実施例に限られるものではない。例えばドナー性分子は上記実施例のTTFの他に、以下のようなものを用い得る。

ジメチルテトラチアフルバレン (DMTTF)、
テトラメチルチアフルバレン (TMTTF)、
ヘキサメチレンテトラチアフルバレン (HMTT
F)、ジセレナジチアフルバレン (DSDTF)、
ジメチルジセレナジチアフルバレン (DMDSD
TF)、ヘキサメチレンジセレナジチアフルバレン
(TSF)、テトラメチルテトラセレナフルバレ
ン (TMTSF)、ヘキサメチレンテトラセレナ
フルバレン (HMTSF)、テトラセレノテトラ

7. 7. 8. 8 - テトラシアノキノジメタン(C TCNQ), 2-704-7, 7, 8, 8-71 ラシアノキノジメタン(BTCNQ)、2.5-ジプロモー7、7、8、8-テトラシアノキノジ メタン (D B T C N Q) 、 2 、 5 - ジョードー 7 . CNQ), 2-000-5-XFN-7.7.8. 8-テトラシアノキノジメタン(CMTCNQ)、 2-プロモー5-メチルー7.7.8.8ーテト ラシアノキノジメタン(BMTCNQ)、2-ョ ード-5-メチル-7.7.8.8-テトラシア ノキノジメタン(IMTCNQ)、11. 11. 12. 12-テトラシアノー2、6-ナフトキノジメタン (TNAP), 1, 1, 2, 3, 4, 4-4+ シアノブタジエン(HCB)、ナトリウム 13. 13. 14. 14ーテトラシアノジフェノキノジメタン (NaTCDQ)、テトラシアノエチレン(TC N E)、o-ペンゾキノン、p-ペンゾキノン、 2, 6-ナフトキノン、ジフェノキノン、テトラ シアノジキノン(TCNDQ)、p-フルオラニ

ル、テトラクロロジフェノキノン。

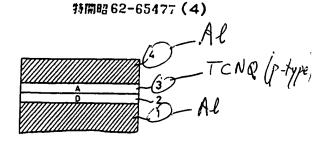
また上記実施例ではドナー性分子層とアクセプタ性分子層のみの積層構造により整茂特性を得るようにしたが、これらの間に絶縁性の有機分子を用いた超期膜を介在させてもよい。

4. 図面の簡単な説明

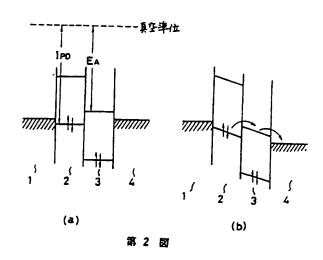
第1回は本発明の一実施例の有機制度整視案子を示す因、第2回(a)(b)はその整流特性を説明するためのパンド図、第3回は同じく得られた整流特性を示す図である。

1 … A & 基板、 2 … ドナー性分子を含むLB額、3 … アクセプタ性分子を含むLB膜、 4 … A & 電極。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦



第1図



電圧・

第 3 図